

授業科目名	【G】 商標法	区分 選択	開講年次	【G】3	単位数	【G】2		
科目区分	専門科目							
授業形態	対面授業							
担当形態	単独							
施行規則に定める科目区分又は事項等								
サブタイトル	商標法の基礎的理解			担当者	中川 淨宗			
授業概要	概要	<p>【実務経験を活かした授業】 弁理士である教員が商標法ないし不正競争防止法について講義する。</p> <p>【概要】 本講義は知的財産制度のうち商標の保護を図ることを目的とする「商標制度」、国民経済の健全な発展を目的とする「不正競争防止法」、および有名人の氏名や肖像を保護する「パブリシティ権」についてはじめて学習する学生を対象にしています。 本講義の主な目的は上記3つの制度の全体像を理解し、技術および意匠と法との関係を理解することです。 具体的には、商標権を取得するためのそれぞれの要件と手続、取得した商標権などの効力とその効力が制限される場合、商標権などの侵害の態様とその救済についての基本的な理解を得ること、そして不正競争防止法によって規制される行為、ならびにパブリシティ権が働く行為について学ぶことを主な目的としています。 本講義では、知的財産制度が単に重要であるというだけでなく、知的財産制度自体がどのようなものになっているのか、その詳細を学び理解することにより、知的財産制度についての学習を将来への糧とするとともに、今後の知的財産制度のあり方について一緒に考えていきましょう。</p>						
	到達目標	<p>1. 商標・不正競争・パブリシティ権を取り扱う知的財産法を理解できる。 2. 上記1の各権利ないし法律を自ら活用できるようになる。 3. 上記1の各制度を他人に説明できるようになる。</p>						
履修条件	特になし							
アクティブ ラーニングの 方法	【－】	事前学習型	【－】	反転授業	【－】	調査学習	【－】	フィールドワーク
	【－】	双方向アンケート	【－】	グループワーク	【－】	対話・議論型授業	【－】	ロールプレイ
	【－】	プレゼンテーション	【－】	模擬授業	【－】	PBL	【○】	その他
ディプロマ・ ポリシーとの 関連性	DP(ディプロマ・ポリシー)①	◎ (よく当てはまる)						
	DP(ディプロマ・ポリシー)②	－ (当てはまらない)						
	DP(ディプロマ・ポリシー)③	－ (当てはまらない)						
	DP(ディプロマ・ポリシー)④	－ (当てはまらない)						
他科目との 関連性	著作権法Ⅰ・Ⅱおよび特許法について、履修または聴講することをお勧めします。 特に特許法については、そこでのご理解を前提にして本講義を進めることがあります。							
教科書	教科書は指定しません。 ただし、商標法・不正競争防止法の各法について、条文を参照できるように、左記の各法が収録された法令集のご準備、またはe-govのウェブサイトなどから左記の各法をダウンロードしてご準備願います。							
参考書	<ul style="list-style-type: none"> ・「産業財産権標準テキスト総合編第4版」(一般社団法人発明推進協会)2019年 ・角田政芳・辰巳直彦「知的財産法」(第9版・有斐閣)2020年 ・中川淨宗「弁理士になりたいと思ったらはじめに読む本」(中央経済社)2021年 							
評価方法	到達度確認テスト(70点満点)、講義内小テスト(30点満点)、および発言などの講義に取り組む姿勢を合算して評価を行います。							
フィードバック 方法	講義中に私からそれまでの講義について質問し、それに対する解答を求めるとともに、受講者から得られた解答について解説を行います。							
評価基準	上記評価方法に挙げた要素を合算して、90点以上でS、80点以上90点未満がA、70点以上80点未満がB、60点以上70点未満がC、60点未満はDないしFとします。ただし、講義内小テストの得点が10点未満の場合は、講義に参加していないものとして、その時点でFと評価します。							

授業科目名	【G】 商標法	区分		開講年次	【G】3	単位数	【G】2
		選択					
授業回数	授業内容						
1	ガイダンス・商標法および不正競争防止法の目的と位置付け 予習： 本講義の概要の確認および特許法を学ぶ意義の確認(90分) 復習： 当回で配布したまとめのプリントの穴埋めを行ってください。(90分)						
2	商標法(1):商標の要件と種類 予習： 第1回講義の配布資料を熟読しておいてください。(90分) 復習： 当回で配布したまとめのプリントの穴埋めを行ってください。(90分)						
3	商標法(2):商標の登録要件(1) 予習： 第2回講義の配布資料を熟読しておいてください。(90分) 復習： 当回で配布したまとめのプリントの穴埋めを行ってください。(90分)						
4	商標法(3):商標の登録要件(2) 予習： 第2および3回講義の配布資料を熟読しておいてください。(90分) 復習： 当回で配布したまとめのプリントの穴埋めを行ってください。(90分)						
5	商標法(4):商標の登録手続 予習： 第2～4回講義の配布資料を熟読しておいてください。(90分) 復習： 当回で配布したまとめのプリントの穴埋めを行ってください。(90分)						
6	商標法(5):商標権の効力・制限 予習： 第2～5回講義の配布資料を熟読しておいてください。(90分) 復習： 当回で配布したまとめのプリントの穴埋めを行ってください。(90分)						
7	商標法(6):商標権の活用手段・消滅事情 予習： 第2～6回講義の配布資料を熟読しておいてください。(90分) 復習： 当回で配布したまとめのプリントの穴埋めを行ってください。(90分)						
8	商標法(7):商標権の侵害と救済・特殊な商標の制度 予習： 第2～7回講義の配布資料を熟読しておいてください。(90分) 復習： 当回で配布したまとめのプリントの穴埋めを行ってください。(90分)						
9	商標法(8):商標の国際的な保護 予習： 第2～8回講義の配布資料を熟読しておいてください。(90分) 復習： 当回で配布したまとめのプリントの穴埋めを行ってください。(90分)						
10	不正競争防止法(1):不正競争とされる行為(1) 予習： 商標法の配布資料を熟読しておいてください。(90分) 復習： 当回で配布したまとめのプリントの穴埋めを行ってください。(90分)						
11	不正競争防止法(2):不正競争とされる行為(2) 予習： 第10回講義の配布資料を熟読しておいてください。(90分) 復習： 当回で配布したまとめのプリントの穴埋めを行ってください。(90分)						
12	不正競争防止法(3):適用除外 予習： 第10および11回講義の配布資料を熟読しておいてください。(90分) 復習： 当回で配布したまとめのプリントの穴埋めを行ってください。(90分)						
13	不正競争防止法(4):不正競争からの救済 予習： 第10～12回講義の配布資料を熟読しておいてください。(120分) 復習： 当回で配布したまとめのプリントの穴埋めを行ってください。(90分)						
14	パブリシティ権:有名人の氏名や肖像の保護 予習： 第1回講義の配布資料を熟読しておいてください。(120分) 復習： 当回で配布したまとめのプリントの穴埋めを行ってください。(90分)						
15	総括と到達度確認テスト 予習： これまでの講義内容をまとめのプリントで確認してください。(120分) 復習： 特になし						
その他	講義内少テスト、到達度確認テスト、授業への参加態度等についての詳細な説明は初回授業で行います。 第1回目の授業には必ず出席してください。						